

ニュースガイドNo, 10495

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中！ <http://www.itdc-patent.com>

*最新の特許情報が満載！

パルスめっき方法と装置

[公開編]平成18年～平成21年(4年間) 68点

	(税込価格)	(本体価格)
全文PDF CD-ROM版(抄録版付)	¥22,050-	¥21,000-
全文紙収録 B5製本版	¥22,050-	¥21,000-
CD-ROM版・B5製本版 一括購入	¥33,075-	¥31,500-

既刊関連セットのご案内

No.	登録・公開	貴金属メッキ方法と工程	平.	点	(本体価格)
No,10429			平.21	72点	¥24,000
No,10293	"	"	平.20	78点	¥25,800
No,10157	"	"	平.19	88点	¥27,500
No,10047	"	"	平.18	89点	¥27,700
No,9920	"	"	平.17	84点	¥25,800
No,9787	"	"	平.16	87点	¥23,400
No,9642	"	"	平.15	76点	¥17,700
No,9443	"	"	平.14	76点	¥17,700
No,9255	"	"	平.13	74点	¥19,000
No,9036	"	"	平.12	66点	¥23,100
No,8811	"	"	平.11	76点	¥26,600
No,8592	"	"	平.10	75点	¥27,000
No,8350	"	"	平.9	74点	¥26,700
No,8087	公告・公開	"	平.8	66点	¥23,400
No,7949	"	"	平.7	72点	¥25,300
No,7796	"	"	平.6	69点	¥24,800
No,8503	"	装飾用パラジウムメッキ方法	平.5-9	53点	¥20,700
No,8497	"	ハードディスク用基板のメッキ方法	平.5-9	66点	¥27,800
No,8298	"	ノン・シアン・メッキ方法と浴の組成	平.1-8	68点	¥29,700
No,8295	"	メタルアレルギー防止メッキ方法	平.5-8	62点	¥26,800

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com)

お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしおりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。]

2～3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会社名	ご注文内容		
	ニュースガイドNo.		
所属部署名	題名	CD-ROM版 or B5製本版 or 一括購入	
		合計 ¥	
担当者名	E-mail:		
	TEL:	FAX:	
住所: 〒			

料金には別途送料がかかります。

パルスめっき方法と装置

No.10495

[公開編] 平成18年～平成21年(4年間)

68点

CD-ROM版 ¥22,050

B5製本版 ¥22,050 (全て税込価格)

(CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥33,075)

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 電子部品の部分めっき装置 | 江東電気株式会社 | 32 磁性膜の製造方法及び磁性膜 | TDK株式会社 |
| 2 配線形成方法 | 株式会社荏原製作所 | 33 電鍍金型及びその製造方法 | 株式会社ナノクリエート |
| 3 パルス電解による物質の製造に係る製造方法、製造装置、物質およびその消費装置 | 日本碍子株式会社 | 34 クロムめっき装置 | 株式会社日立製作所 |
| 4 配線基板の製造方法 | 新光電気工業株式会社 | 35 塩化物イオン濃度の測定・管理装置及び方法 | 新光電気工業株式会社 |
| 5 微細孔に対するメッキ方法、及びこれを用いた金バンプ形成方法及半導体装置の製造方法、並びに半導体装置 | シャープ株式会社 | 36 クロムめっき部品 | 株式会社日立製作所 |
| 6 内部ピアホールの充填メッキ構造及びその製造方法 | 三星電機株式会社 | 37 配線基板または半導体回路の電気銅めっき液のモニター方法 | 公立大学法人大阪府立大学 |
| 7 クロムめっき部品の製造方法 | 株式会社日立製作所 | 38 磁気記録装置の製造方法及び磁気記録装置 | 富士通株式会社 |
| 8 Au-Sn合金のめっき皮膜 | 株式会社ナウケミカル | 39 粗化圧延銅板およびその製造方法 | 古河電気工業株式会社 |
| 9 磁性薄膜及びその製造方法、並びに、磁気ディスク装置 | 富士通株式会社 | 40 めっき方法およびこれに使用するめっき装置 | 株式会社荏原製作所 |
| 10 メッキ装置 | TDK株式会社 | 41 パルス銅めっき浴用添加剤およびこれを用いたパルス銅めっき浴 | 荏原ユーザライト株式会社 |
| 11 微細Viaホールを有する基板への電解めっき方法 | 日立協和エンジニアリング株式会社 | 42 酸性銅電気メッキ溶液のパルス逆電解法 | マクダーミッド インコーポレーテッド |
| 12 マイクロビアやスルーホールをめっきする方法 | アトーテヒ ドイツチュラントゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル... | 43 隔離された陽極液区画における補助電極をもつ電気化学めっきセル | アブライド マテリアルズ インコーポレイテッド |
| 13 電気めっき槽 | エントーン インク. | 44 電流プロフィールの可変による銅メッキ硬度を制御するための電解メッキ方法 | マクダーミッド インコーポレーテッド |
| 14 メッキ用電源装置 | 株式会社三社電機製作所 | 45 ゲート誘電体上にゲート金属または他の導体材料または半導体材料を電着するための方法(ゲート誘電体貫通負の電流をパルスする電着を用いた合金堆積物の製造及びそのナノ構造の制御方法、並びにそのような堆積... | インターナショナル・ビジネス・マシーンス・コーポレーション |
| 15 電気めっき法 | ヘッドウェイテクノロジーズ
インコーポレイテッド | 46 物品への耐水素性付与方法 | マサチューセッツ インスティテュート オブ テクノロジー |
| 16 銅ストライクめっき方法 | 新光電気工業株式会社 | 47 銅めっき用添加剤およびこれを用いる電子回路基板の製造方法 | 日立金属株式会社 |
| 17 熱相互接続システムの生成方法およびその使用方法 | ハネウエル・インターナショナル・インコーポレーテッド | 48 パラジウム-コバルト合金めっき液、パラジウム-コバルト合金被膜の形成方法及びパラジウム-コバルト... | 荏原ユーザライト株式会社
有限会社 サンキュー |
| 18 放熱体 | 国立大学法人信州大学 | 49 回路基板及びその製造方法 | パナソニック電工株式会社 |
| 19 めっき構造物とその製造方法 | 国立大学法人信州大学 | 50 高速パルス電源装置 | 株式会社中央製作所 |
| 20 リードフレーム | 株式会社三井ハイテック | 51 高速反転パルス電源装置 | 株式会社中央製作所 |
| 21 電気メッキ装置 | アルプス電気株式会社 | 52 酸性電解銅めっき液およびこれを用いる微細配線回路の作製方法 | 荏原ユーザライト株式会社 |
| 22 電解メッキ法 | 三星電機株式会社 | 53 PRパルス電解めっきの計測装置 | 新光電気工業株式会社 |
| 23 亜鉛めっき処理方法 | 名古屋市 | 54 銅 亜鉛合金電気めっき方法、それを用いたスチールワイヤ、スチールワイヤゴム接着複合体およびタイヤ | 株式会社ブリヂストン |
| 24 プリント配線板の製造方法及びプリント配線板並びにめっき・エッチング・研磨処理装置 | 株式会社トッパンNECサーキットソリューションズ | 55 半導体基板の電解めっき方法および電解めっき装置 | 株式会社フジクラ |
| 25 金めっき膜およびその製造方法 | 国立大学法人信州大学 | 56 伝導材料中の構造を画定し、複製するための方法及び電極 | レプリサウルス テクノロジーズ アクティブポラーク |
| 26 電極組立体およびめっき装置 | TDK株式会社 | 57 リードフレーム | 株式会社三井ハイテック |
| 27 R-Fe-B系希土類焼結磁石の製造方法 | 日立金属株式会社 | 58 酸性銅用前処理剤およびこれを利用するめっき方法 | 荏原ユーザライト株式会社 |
| 28 めっき方法及びめっき装置 | 株式会社荏原製作所 | 59 金属層の電解析出のための方法 | アトーテヒ ドイツチュラントゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル... |
| 29 抵抗性半導体ウェハ上に薄膜を電気化学処理するための装置及び方法 | インターナショナル・ビジネス・マシーンス・コーポレーション | 60 電気めっきによって基材表面を金属でコーティングする方法 | アルスィメール |
| 30 亜鉛ランタノイドスルホン酸電解質 | アーケマ・インコーポレイテッド | | |
| 31 電解めっき方法 | 日本マクダーミッド株式会社 | | |

以下7点省略